

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公開番号】特開2019-6669(P2019-6669A)

【公開日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2019-002

【出願番号】特願2018-106563(P2018-106563)

【国際特許分類】

C 03 C 21/00 (2006.01)

C 03 B 33/02 (2006.01)

B 28 D 5/00 (2006.01)

【F I】

C 03 C 21/00 101

C 03 B 33/02

B 28 D 5/00 Z

【手続補正書】

【提出日】令和3年6月4日(2021.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を活性領域及びダイシングレーンにパターン化することと、

前記基板をパターン化した後、1つ以上の応力層を前記基板に形成することと、を含み、

前記活性領域における前記基板の厚さに沿う応力の変化が、前記ダイシングレーンにおける前記基板の前記厚さに沿う応力の変化より大きく、前記ダイシングレーンの厚さの約50%を超えて通って伸展する前記応力層を形成する、方法。

【請求項2】

前記基板をパターン化することが、ガラス基板を前記活性領域及び前記ダイシングレーンにパターン化することを含み、

前記応力層を形成することが、前記ガラス基板をイオン槽に配置することと、イオン交換された層を前記ガラス基板内に形成することと、を含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記基板を前記ダイシングレーンに沿ってダイシングすることによって個片化された基板を形成することを更に含む、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記ダイシングレーンにおける前記基板の前記厚さに沿う前記応力の変化が、実質的にゼロである、請求項1に記載の方法。

【請求項5】

活性領域及びダイシングレーンを有する基板を含む部分組立品であって、前記活性領域及び前記ダイシングレーンのうちの一方または両方がイオン交換され、前記ダイシングレーンは、前記基板の厚さに沿う応力の変化が、前記活性領域における前記基板の厚さに沿う応力の変化未満である応力プロファイルを有し、前記ダイシングレーンが、イオン交換されたダイシングレーンを含む、部分組立品。

【請求項6】

前記ダイシングレーンにおける応力が、実質的に均一である、請求項5に記載の部分組立品。

【請求項7】

前記ダイシングレーンが、イオン交換されないダイシングレーンを含む、請求項5に記載の部分組立品。

【請求項8】

基板であって、1つ以上の応力層を含む活性領域、及び少なくとも前記基板の外周に沿って配置されたダイシングレーンを有し、前記ダイシングレーンにおける前記基板の厚さに沿う応力の変化が、前記活性領域における前記基板の前記厚さに沿う応力の変化未満である、基板と、

前記基板の表面上に配置された電気回路、
と、を含み、

前記電気回路が、前記基板の自壊を開始するように構成された少なくとも1つの構成要素を含む、組立品。